VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMmeNARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

An:			ERCHENBEHÖRDE		PCT
	siehe Form	nular PCT/ISA.	/220	IN' RECH	LICHER BESCHEID DER TERNATIONALEN HERCHENBEHÖRDE
		,		Absendedatum	egel 43 <i>bis</i> .1 PCT)
				(TagMonatUahr) sie	he Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)
	nzeichen des Anmeld le Formular PCT/			WEITERES VORO	GEHEN
	nationales Akterizeich I/DE2004/000804		Internationales Anmelded 15.04.2004	atum (TagMonattlahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 15.04.2003
inten H01	nationale Patentklass L21/3065, H01L2	ifikation (IPK) ode 21,308, H01L2	er nationale Klassifikation u 9/06	nd IPK	
Anm	elder CHNISCHE UNIV				
1.	Dieser Bescheit	d enthält Anga	aben zu folgenden Pu	nkten:	•
	☑ Feld Nr. I	Grundlage des	Bescheids		
	Feld Nr. II	Prioritāt	•		. The state of the
	Feld Nr. III	Keine Erstellur Anwendbarkeit	ng eines Gutachtens übe t	er Neuhelt, erfindensc	he Tätigkeit und gewerbliche
	☐ Feld Nr. IV	MangeInde Ein	heitlichkeit der Erfindun	9	
	☑ Feld Nr. V				h der Neuheit, der erfinderlschen Tätigkeit
				Unterlagen und Erkläi	rungen zur Stützung dieser Feststellung
	☐ Feld Nr. VI		geführte Unterlagen		
			ngel der internationalen		
	☑ Feld Nr. VIII	Bestimmte Ber	merkungen zur internatio	onalen Anmeibung	
2.	WEITERES VOR				
	mit der internation eine andere Behö mitgeteilt hat, dat	nalen vorläufige 5rde als diese a 8 schriftliche Be	en Prufung beautragten dis IPEA wählt und die g escheide dieser Internati	ewählte IPEA dem Intonalen Recherchenbe	scheid als schriftlicher Bescheid der as trifft nicht zu, wenn der Anmelder emationale Büro nach Regel 66.1 bis b) shörde nicht anerkannt werden.
	aufgefordert, bei	der IPEA vor A	blood voc 3 Monaton an	dem rag, an dem da: sdatum, ie nachdem, v	EA gilt, so wird der Anmelder s Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt welche Frist später abläuft, eine then.
	Weitere Optioner	n siehe Formbla	att PCT/ISA/220.		
3.	•		nmerkungen zu Formbl	att PCT/ISA/220.	
	ne und Postanschrift o		- Samples	Bevollmächtigter Bed	lenstater

Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt - Gitschlner Str. 103 D-10958 Berlin Tel. +49 30 25901 - 0 Fax: +49 30 25901 - 840

Klopfenstein, P

Tel. +49 30 25901-775



10/553728

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/000804

JC20 Rec'd PCT/PTO 1 4 OCT 2009

_	rei	Nr. 1 Grundlage des Bescheids
1.		sichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache ellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
		Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2.	wur	sichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart de und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt den:
	a. A	rt des Materials
		Sequenzprotokoli
	(Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
	b. F	orm des Materials
		in schriftlicher Form
	כ	in computerlesbarer Form
	c. Z	eitpunkt der Einreichung
		I in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
	ב	zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
	כ	bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.		Wurden mehr als eine Version oder Kople eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Koplen mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
Á	71106	itzliche Remerkungen:

Formblatt PCT/PEA/237 (Januar 2004)

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/000804

_	Fe	ld Nr. II	Prioritāt				•
1	. 🛭	Das fo	lgende Dokument is	noch nic	ht eingereich	nt worden:	
		⊠	Abschrift der früher und 66.7(a)).	en Anme	ldung, deren	Priorităt be	eansprucht worden ist (Regel 43 <i>bis</i> .1
			Übersetzung der fri und 66.7(b)).	iheren Ar	nmeldung, de	eren Priorita	åt beansprucht worden ist (Regel 43bis.1
		Daher in der A	war es nicht möglich Annahme erstellt, da	, die Gült 6 das bea	igkeit des Pr anspruchte F	ioritātsansp Prioritātsdat	oruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzder um das maßgebliche Datum ist.
2.		Priorita	tsanspruch als ungü	itig erwie	sen hat (Reg	jeln 43 <i>bis</i> .1	en Priorität erstellt worden, da sich der I und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids datum als das maßgebliche Datum.
3.	Etw	aige zu:	sātzliche Bemerkung	en: ·			
_	erfi	d Nr. V inderisc itzung d	Begründete Fest hen Tätigkeit und d leser Feststellung	stellung Ier gewe	nach Regel rblichen An	43 <i>bis</i> .1(a)(wendbark	(I) hinsichtlich der Neuhelt, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur
_ _ 1.	erfi Stū	nderisc	hen Tätigkeit und d leser Feststellung	stellung ler gewe	nach Regel rblichen Aπ	43 <i>bis</i> .1(a)(wendbarke	(I) hinsichtlich der Neuhelt, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur
_ _ 1.	erfi Stü Fes	nderisc tzung d	hen Tätigkeit und d leser Feststellung	stellung der gewe	rblichen An	wendbarke	(I) hinsichtlich der Neuhelt, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur
_ 1.	erfi Stü Fes	nderisc itzung d itstellung	hen Tätigkeit und d leser Feststellung	ler gewe	rblichen An	wendbarke	(I) hinsichtlich der Neuhelt, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur
1.	erfi Stū Fes Neu	nderisc itzung d ststellung iheit	hen Tätigkeit und d leser Feststellung	ler gewe	Ansprüche Ansprüche	4-8 1-3	(I) hinsichtlich der Neuhelt, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur
	erfi Stū Fes Neu	nderisc itzung d ststellung iheit	hen Tätigkeit und d leser Feststellung	Ja: Nein: Ja:	Ansprüche	4-8 1-3	(I) hinsichtlich der Neuhelt, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur
1.	erfi Stū Fes Neu	inderisc itzung d itstellung iheit inderisch	hen Tätigkeit und d leser Feststellung	Ja: Nein: Ja:	Ansprüche Ansprüche Ansprüche	4-8 1-3 5 4, 6-8	(I) hinsichtlich der Neuhelt, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur
1.	erfi Stū Fes Neu	inderisc itzung d itstellung iheit inderisch	hen Tätigkeit und d leser Feststellung ; e Tätigkeit	Ja: Nein: Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche	4-8 1-3 5 4, 6-8	(I) hinsichtlich der Neuhelt, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur
	erfi Stū Fes Neu Erfi	nderisc itzung d itstellung uheit inderisch	hen Tätigkeit und d leser Feststellung ; e Tätigkeit	Ja: Nein: Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche	4-8 1-3 5 4, 6-8	(I) hinsichtlich der Neuheit, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur
	erfistū Fes Neu Erfi	nderisc itzung d itstellung uheit inderisch	hen Tätigkeit und dieser Feststellung e Tätigkeit e Anwendbarkeit und Erklärungen:	Ja: Nein: Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche Ansprüche	4-8 1-3 5 4, 6-8	(I) hinsichtlich der Neuhelt, der elt; Unterlagen und Erklärungen zur

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Belblatt

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000804

Zu Punkt I

Grundlage des Bescheides

Der Prüfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

Beschreibung:

Seiten 1-11 in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Claims

Ansprüche 1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Zeichnungen

Seiten 1/8 - 8/8 in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Zu Punkt Y

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

In diesem Bescheid sind folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente D1 bis D4 genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1 = US-A-6198150

D2 = US-A-6180466

D3 = B. YOLLAND et al., Journal of Vacuum Sci. & Techno.B, Microelectronics Processings and Phenomena, Bd.17; Nr.6, November 1999, Seiten 2768-2771 D4 = DE-A-19736370

V.1 MangeInde Neuheit

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-3 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

V.1.1 Anspruch 1

Die Merkmale des Anspruchs 1 beziehen sich auf ein Verfahren zur Herstellung einer Struktur, und nicht auf die Definition der Struktur anhand ihrer technischen (strukturellen) Merkmale. Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im

Formblatt PCT/Beiblatt/237 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000804

Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus dem Anspruch hervor.

Anspruch 1 würde als eine Struktur mit folgenden Merkmalen interpretiert:

Eine Struktur in einem Siliziumsubstrat, mit positivem Profil, bestimmtem Böschungswinkel und mit einer Maske abgedeckt, die Struktur bestehend aus:

- im oberen Teil, einer Maskenunterätzung, deren Tiefe annähernd gleich deren lateralen Abmessung ist;
- im restlichen Teil, Seitenwände mit definiertem Böschungswinkel.

Eine solche Struktur ist aus **D1** bekannt, siehe Abb.2C (s. auch Spalte 3, Zeile 38 bis Spalte 4, Zeile 12), sowie aus **D2**, Abb.1F (s. auch Spalte 5, Zeile 66 bis Spalte 6, Zeile 40).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

V.1.2 Anspruch 2.

In der Beschreibung wird die Verwendung eines Plasmas aus SF_6 sowohl für isotropes (s. Seite 11, Tabelle 1, Schritt 1 und Seite 2, vierten Absatz) als auch für anisotropes (s. Seite 11, Tabelle I, Schritt 2) Silizium-Ätzen vorgeschlagen. Wie es dem Fachmann weitgehend bekannt ist, ist ein Plasma-Ätzschritt mit SF_6 an sich im Normalfall isotrop (s. Anspruch 3 und Seite 2, vierten Absatz). Anisotropie entsteht, wenn ein SF_6 -Plasmaätzen in Verbindung mit Seitenwandpassivierung durchgeführt wird (s. Seite 2, letzten Absatz und ASE-Prozeß im letzten Abs. von Seite 3).

Der Ātzschritt (b) von **Anspruch 2** entspricht also einer Kombination aus einem <u>isotropen</u> Plasma-Ātzschritt (z.B. SF₆-Plasma) und einem Polymerisationsschritt (z.B. mittels C₄F₈-Plasma). Wird vor diesem Ātzschritt (b) ein erster isotroper Ātzschritt (a) durchgeführt (z.B. mittels SF₆-Plasma), entspricht dann einem solchen Zyklus der Schritte (a)-(b), entweder einer Folge von drei Plasma-Schritten mit SF₆-C₄F₈ SF₆ wenn in (b) mit dem Polymerisationsschritt angefangen wird, oder einer Folge von drei Plasma-Schritten mit SF₆-SF₆-C₄F₈ wenn in (b) mit Ätzen angefangen wird (dies entspricht eine Folge von SF₆-C₄F₈ Schritten, weil die zwei SF6-Schritten, die in direkter Folge durchgeführt werden, als ein Schritt betrachtet werden können).

In beiden Fällen, entspricht die Wiederholung der Schritte (a)-(b)-(a)-(b)-... einer Folge von Plasmaschritten mit $SF_e-C_4F_8-SF_6-C_4F_8-...$

Schritt c) wird als im Schritt (b) enthalten betrachtet, weil während des SF₈-Plasma Ätzens vom Schritt (b) das Polymer von dem Boden aber auch (teilweise) von den

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000804

Seitenwänden der geätzten Struktur abgetragen wird.

Die Wiederholung der Schritten (a)-(b)-(c)-(a)-(b)-(c)-... entspricht also einer Folge der Schritte (a)-(b)-(a)-(b)-... (z.B. Plasmaschritten mit $SF_6-C_4F_8-SF_6-C_4F_8-...$)

Eine solche Folge ist in D3 dargestellt.

Dokument D3 offenbart (s. Seite 2769, linke Spalte, Kapitel II und Abb.1) ein Verfahren zum Plasmaätzen zur Erzeugung positiver (siehe die drei letzten Zeilen vor Beginn des Kapitels III) Ätzprofile mit definiertem Böschungwinkel in Si-Substraten, bei dem das Si-Substrat mit einer Maske abgedeckt wird, mit folgenden Schritten:

- isotropes Ātzen (in einem SF_6 -Plasma), so daß die laterale Maskenunterätzung annähernd gleich der Ātztiefe ist (s. erste Zeichnung der Abb.1);
- anisotropes Ātzen mit alternierend aufeinanderfolgenden Polymerisationsschritten (in einem C_4F_8 -Plasma) und Ātzschritten (in einem S ξ -Plasma) so daß die Ātztiefe mit konstanter Maskenunterätzung vergrößert wird und die Seitenwände der Struktur mit einem Polymer belegt werden (s. zweite und dritte Zeichnung der Abb.1);
- Wiederholung dieser Schritte bis das vorgegebene Ātzprofil erzeugt wird. (s. vierte und fünfte Zeichnung der Abb.1).

Die SF₆-Plasmaätzschritte und der C4F8-Plasma Polymerisierungsschritt wurden auch im Ausführungsbeispiel der Anmeldung, Seite 11, Tabelle 1 dargelegt. Eine Abtragung des Polymers von dem Boden und (teilweise) von den Seitenwänden der geätzten Struktur erfolgt mit jedem der SF₆-Plasmaschritte.

Der Gegenstand der Ansprüche 2, 3 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

V.2 Mangelnde erfinderische Tätigkeit

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil ungeachtet der fehlenden Klarheit (siehe Absatz VIII), der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 4, 6-8. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht.

V.2.1 Bezüglich der Parameter aus Anspruch 4 handelt es sich nur um übliche Dauer und Druckbereiche für Plasmaätzschritte, deren Aufnahme der Fachmann daher das in D3 beschriebene Verfahren ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde.

Formblatt PCT/Beiblatt/237 (Blatt 3) (EPA-Januar 2004)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000804

V.2.2 Als Aufgabe des beanspruchten Verfahrens wird angegeben (s. Seite 4, zweiten und dritten Absätze), eine Lösung zu finden, um den Böschungswinkel der Seitenwände des Ätzprofils zu bestimmen. Als einzige Lösung wird vorgeschlagen, die Auswahl des Zeitverhältnisses für die Schritte (a) und (b) zu bestimmen (s. Seite 8, ersten und zweiten Absätze, sowie Bilder 9-17).

Die Dauer des Polymerisationsschritts spielt eine entscheidende Rolle in der Bestimmung des Ätzprofils. Zum Beispiel erzeugt eine kurze Dauer des Schritts (b) eine dünne Polymerschicht, die leichter von den Seitenwänden abgetragen wird und zu mehr Isotropie führt und zu einem entsprechend kleineren Böschungswinkel (positives Ätzprofil, s. rechtes Teil von Bild 9). Im Gegensatz führt eine dicke Polymerschicht zu senkrechten Profilen (90° Böschungswinkel, s. linkes Teil von Bild 9).

Diese Auswahlmöglichkeiten und die sich ergebenden Effekte sind aus **D4** bekannt (s. Spalte 2, Zeile 62 bis Spalte 3, Zeile 1 und Spalte 3, Zeilen 30-38). In diesem Dokument wird ein anisotropes Plasma-Ātzverfahren dargestellt, das aus einer Wiederholung von aufeinanderfolgenden Plasmaätz- (z.B. SF₆) und Polymerisierungsschritten (z.B. C₄F₈) besteht (siehe Spalte 4, Zeile 46 bis Spalte 5, Zeile 21, was identisch ist mit dem anisotropen Ātzschritt von **D3**).

Dokument **D**4 beschreibt hinsichtlich der Merkmale der **Ansprüche 6, 7, 8** dieselben Vorteile für denselben Zweck wie die vorliegende Anmeldung, im Rahmen eines ähnlichen Verfahrens wie das von **D3**. Dem Fachmann, der die Aufgabe verfolgt, das Ātzprofil aus D3 zu variieren und/oder zu bestimmen, ist es ohne weiteres möglich, die genannten Merkmale aus D4 mit entsprechender Wirkung auch beim Verfahren von **D3** anzuwenden. Somit bedürfte es keiner erfinderischen Tätigkeit, um zum Verfahren gemäß der **Ansprüche 6-8** zu gelangen.

Die in den **Ansprüche 6, 7, 8** der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagenen Lösungen können aus diesen Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT).

Zu Punkt VIII

VIII.1 Im vorliegenden Anspruch 4 werden bezüglich des anisotropen Ätzvorgangs, "Intervallzeiten" von 3 bis 12 Sekunden beansprucht. Da der Begriff "Intervallzeiten" in keiner der Ansprüche 2 bis 4 definiert ist, wird er entsprechend der Beschreibung (siehe "zeitliche Anteil" in Seite 8, Zeilen 1-6) als die Dauer des anisotropen Ätzvorgangs interpretiert, der aus Polymerisations- und Ätzschritte besteht (siehe in Seite 11, Tabelle

Formblatt PCT/Belblatt/237 (Blatt 4) (EPA-Januar 2004)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000804

1, "modifiziertes ASE"). Laut Tabellen 1 und 2 dauert dieser Schritt (b) 13 Sekunden (5s.+ 8s.). Die Anmeldung erlaubt keinen anderen Interpretationsraum.

Daher fallen die in den Tabellen 1 und 2 beschriebenen dargestellten Ausführungsbeispiele nicht unter den vorliegenden Anspruch 4. Dieser Widerspruch zwischen Anspruch 4 und der Beschreibung führt zu Zweifeln bezüglich des Gegenstandes des Schutzbegehrens, weshalb der Anspruch 4 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

VIII.2 Die Aufgabe des beanspruchten Verfahrens ist es eine Lösung zu finden, um den Böschungswinkel der Seitenwände des Ätzprofils zu bestimmen, siehe Seite 4, zweiter und dritter Absatz.

Als einzige Lösung wird die Bestimmung der Auswahl des Zeitverhältnisses für die Schritte (a) und (b), angegeben, siehe Seite 8, erster und zweiter Absatz sowie Abbildungen 9-17) so daß das Merkmal aus **Anspruch 6** für die Definition der Erfindung wesentlich ist.

Da der unabhängige **Anspruch 6** diese Merkmale nicht enthält, entspricht er nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.

(Dieses Merkmal ist aber aus D4 bekannt, siehe Absatz V.2.2).

VIII.3 Im vorliegenden Anspruch 6 ist der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert:

Laut des Ausführungsbeispiels der Tabellen 1, 2. enthalten beide Schritte (a) und (b) einen SF₆-Plasma-Ātzschritt: Diese beiden SF6-Plasmaschritte werden als ein einziger SF₆-Plasmaschritt betrachtet, wenn sie direkt aufeinanderfolgen (dazu siehe auch Absatz V.1.2).

Die Schritte (a) und (b) enthalten also zwei Ätzschritte (die identisch sein können) und einen Polymensationsschritt. Daher ist der in dem **Anspruch 6** benutzte Ausdruck "eines Zeitverhältnisses zwischen den Schritten (a) und (b)" vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen: welche Dauer (Zeitverhältnis) von welchem Schritt ist damit gemeint?

Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands des **Anspruchs 6** aber auch der **Ansprüche 7 und 8** nicht klar ist und daher nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT entsprechen.

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000804

Klarheit könnte erreicht werden, wenn in Anspruch 6 die Dauer jeder der drei Plasma-Schritte von (a) und (b) angegeben wäre.

Formblatt PCT/Belblatt/237 (Blatt 6) (EPA-Januar 2004)

.